

規格品装置

スパッタ装置

Sputtering Systems

多元スパッタ・同時スパッタを実現する
研究用スパッタ装置の決定版。

- 研究・開発に適したエコノミータイプ
- コンパクトで低価格
- 多元スパッタ、同時スパッタが可能(オプション)

用途

- 電池材料
- マイクロマシン
- ガスバリア膜
- 透明導電膜
- 光学薄膜
- 磁性薄膜
- 各種合金薄膜



SR-350DS-31-N標準仕様

スパッタ室	<ul style="list-style-type: none"> ●円筒側面開閉式真空チャンバ 寸法：約φ350×D270 材質：SUS304 ●到達圧力 5×10⁻⁵Pa以下 ●のぞき窓 ●ガス導入系 ●カソード電極取付ポート×3 ●予備ポート
電極・サブストレート	<ul style="list-style-type: none"> ●基板寸法 ウエハφ3インチ ●カソード電極 3インチマグネトロン×1(合計3個まで増設可能) ●サブストレートホルダ モータ回転式3~30rpm 平面タイプ(水冷) ●成膜速度 60nm/min(AL) ※ターゲット—基盤間距離=70mm ●膜厚分布 φ60の範囲で±10% ※ターゲット—基盤間距離=70mm
真空排気系	<ul style="list-style-type: none"> ●排気ユニット 高真空排気装置 DS-412Z 油拡散ポンプ、油回転ポンプ、液体窒素トラップ ●真空計 広域電離真空計、ピラニ真空計
電気系	<ul style="list-style-type: none"> ●高周波電源 300W 13.56MHz AC200V ●マッチングボックス 手動3点切替器
安全対策	<ul style="list-style-type: none"> ●断水リレー
ユーティリティ	<ul style="list-style-type: none"> ●設置寸法 約W2200×D1300×H1500(mm) ●Arガス 5~30kPa ●冷却水 0.13~0.15 MPa 6L/min ●電源容量 3φ 200V 4.2kVA
オプション	<ul style="list-style-type: none"> ●マルチカソード電極 3インチマグネトロンを2個増設可能 ●RF電源切替器 ●DC電源 ●逆スパッタ機構、バイアススパッタ機構 ●基板位置決め機構 ●基板加熱機構 ●マスフローコントローラ 2系列 ●ターボ分子ポンプ

※2インチ、4インチターゲットも可能です。

※上記以外の仕様については、ご相談ください。

※外觀・仕様については改善のため予告なく変更する場合があります。

大亜真空株式会社

DIAVAC LIMITED

本社営業部 / 〒276-0046 千葉県八千代市大和田新田495
TEL.047-459-7628(ダイヤルイン) FAX.047-459-3654

大阪営業所 / 〒532-0002 大阪市淀川区東三国2-34-1 ハイランドビル4F
TEL.06-6396-1771(代表) FAX.06-6396-1774

本社・工場 / 〒276-0046 千葉県八千代市大和田新田495
TEL.047-459-5311(代表) FAX.047-459-3628
<https://www.diavac.co.jp/>

このカタログは古紙を使用しています。

特約店